

磁控溅射系统

所属学校:重庆大学

仪器基本信息			仪 器 编 号		03020288			
			仪器英文名称		Magnetron Sputtering Device			
			所属校内单位		物理学院			
			放 置 地 点		虎溪校区 DS1103			
			仪器负责人		方 亮	制造商国别	中国	
			制 造 厂 商		沈阳中科科仪技术开发公司			
			规 格 型 号		JGP450			
			仪 器 原 值		29.00 万元	购置日期	2003.08	
仪器性能信息	主要技术指标	射频电源,输出功率 0 ~ 500W;直流溅射电源输出功率 0 ~ 2kV;真空度:极限真空 10 ⁻⁵ Pa;工作真空 10 ⁻⁴ Pa;靶直径: 60mm; 靶基距:40 ~ 80mm(可调);基片直径: 40mm,6 个。						
	主要功能及特色	利用直流或射频方法制备各种薄膜及器件:如氧化膜;高熔点的介质膜;金属电极;以及二极管,发光器件,电子器件等,可用于教学和科研,社会服务。						
相关科研信息	主要研究方向	材料、材料物理、功能材料、薄膜材料。						
	在研或曾承担的重大项目	为物理学院的研究生培养及科研的平台。						
	学术 论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:						
		序号	作者	论文题目	期刊名称	年	卷(期)	起止页
		1	Bo Yin	Preparation and properties of super - hydrophobic coating on magnesium alloy	Applied Surface Science	2010	257	1666 - 1671
		2	L. Fang	Effect of Ga doping concentration on electrical and optical properties of nano ZnO transparent conductive films	J Supercond Nov Magn	2010	23	885 - 888
3	L. P. Peng	Effect of Substrate Temperature on the Properties of Nano - ZnO; In Transparent Conductive Films	J Supercond Nov Magn	2010	23	881 - 883		
专利或奖项	1. 方亮,胡佳等,铝合金上制备 Ni - Co - P/Si3N4 镀层的化学复合镀方法,申请号 201010165287.5 2. 方亮,殷波等,一种镁合金表面超疏水涂层的制备方法,申请号 201010165310.0 3. 方亮,胡釜等,镁合金在酸性溶液中 Ni - Co - P 镀层的化学镀方法,申请号 200910104521.0							
共享服务信息	收费标准	联盟外	400 元/小时(不包括原材)					
		联盟内	200 元/小时(不包括原材)					
	联系信息	联系人	刘高斌	联系电话	65105870	电子邮件	gbl@cqu.edu.cn	
开放时间	提前预约							